This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-291501

(43)Date of publication of application: 03.12.1990

(51)Int.CI.

Ì,

G02B 1/10

(21)Application number: 01-111497

(71)Applicant: HOYA CORP

(22)Date of filing:

28.04.1989

(72)Inventor: NISHIO TAKASHI

SUZUKI TOKIO

(54) ANTIREFLECTION FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve scratching resistance, adhesive property and heat resistance by formir the antireflection film having an underlying layer, a 1st layer, a 2nd layer and a 3rd layer in sucl a manner that the titanium dioxide in the 1st layer consisting of 3-layered equiv. films and the titanium dioxide in the 2nd layer are deposited by evaporation while a base material is irradiate with an oxygen ion beam on a base material.

CONSTITUTION: The antireflection film provided on the plastic base material has, counted fro the base material side, the underlying layer consisting of silicon dioxide, the 1st layer consisting of the 3-layered equiv. films constituted of the titanium dioxide layer, the silicon dioxide layer and the titanium dioxide layer, the 2nd layer consisting of the titanium dioxide and the 3rd layer consisting of the silicon dioxide. This antireflection film is so formed that the titanium dioxide layer in the 1st layer consisting of the 3-layered equiv. films and the titanium dioxide of the 2r layer are deposited by evaporation while the base material is irradiated with the oxygen ion beam. Not only the basic properties, such as scratching resistance and adhesive properties, ar satisfied but also the excellent heat resistance is obtd. even when the substrate is made of a plastic lens. The generation of cracks at the time of heating is thus obviated and the excellent antireflection effect is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2-291501

®Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月3日

G 02 B 1/10

A 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

図発明の名称 反射防止膜

②特 頤 平1-111497

②出 願 平1(1989)4月28日

 ⑩発明者
 西尾
 俊

 ⑩発明者
 鈴木
 時夫

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

勿出 顋 人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

⑭代 理 人 弁理士 中村 静男

明細書

1.発明の名称

反射防止膜

2.特許請求の範囲

- (1) プラスチック基材上に設けられる反射防止膜において、基材側から数えて、二酸化ケイ案からなる下地層;二酸化チタン層、二酸化ケイ素層および二酸化チタン層によって構成される3層等価膜からなる第1層;二酸化チタンからなる第2層;及び二酸化ケイ素からなる第3層を有してなり、前記3層等価膜からなる第1層中の二酸化チタン層および前記第2層の二酸化チタン層および前記第2層の二酸化チタンが基材に酸素イオンビームを照射しながら蒸着されたものであることを特徴とする反射防止膜。
- 3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えばプラスチックレンズ等のプラ スチック基材上に設けられる反射防止膜に関する。

[従来の技術]

ジエチレングリコールピスアリルカーボネート 樹脂(一般にCR-39樹脂と呼ばれている)などのプラスチック基材の表面の反射特性を改善的 ために、このプラスチック基材上に多層反射防止膜を設けることは良く知られている。このような反射防止膜として、例えば特開昭56-11603号公報には、基材側から数えて、二酸化ケイ素からなる膜厚が3/2λの下地層と、二酸化ケイ素層によって構成される2層等価膜からなる合計膜厚が約λ/4の第2層と、二酸化ケイ素からなる膜厚が約λ/4の第2層と、二酸化ケイ素からなる膜厚が約λ/4の第3層とを有する反射防止膜が開示されている。

[発明が開示しようとする課題]

特開昭56-116003号公報に開示されている反射防止膜は、充分な耐擦傷性、密着性を有するが、耐熱性が不充分で、この反射防止膜を設けたプラスチックレンズを加熱して例えばセルロ

ース製眼鏡フレームに枠入れする際に、反射防止 腹にクラックが生じやすいという問題点があった。 またこの反射防止膜を施したプラスチックレンズ の視感反射率は約1.5%であり、この反射防止 膜付きプラスチックレンズを眼鏡レンズとして使 用した場合、ゴースト現象は完全に解消されているとは言えないという問題点があった。従ってファッション面から、プラスチックレンズを基板と したときに、ゴースト現象が起りにくい反射防止 膜の開発が望まれていた。

従って本発明の目的は、耐擦傷性、密着性等の基本的性質を満足するだけでなく、基板をプラスチックレンズとしたときに、従来の反射防止膜よりも耐熱性に優れ、加熱時にクラックが生じることがなく、しかも反射防止効果に優れ、ゴースト現象が起りにくい反射防止膜を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は上述の課題を解決するためになされた 。ものであり、プラスチック基材上に設けられる反

の密着性を高め、かつ反射防止膜の硬度を向上させて耐摩耗性を高めるためである。

次に、前記の下地層の上に形成される第1層は、 二酸化チタン層、二酸化ケイ素層および二酸化チ タン層によって構成される3層等価膜である。こ 射防止膜において、基材側から数えて、二酸化ケイ素からなる下地層:二酸化チタン層、二酸化ケイ素層および二酸化チタン層によって構成される 3 層等価膜からなる第1層:二酸化チタンからなる第2層:及び二酸化ケイ素からなる第3層を有してなり、前記3層等価膜からなる第1層中の二酸化チタン層および前記第2層の二酸化チタンが基材に酸素イオンピームを照射しながら蒸音されたものであることを特徴とする反射防止膜を襲旨とするものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の反射防止膜は、プラスチック基材上に、下地層を設け、次に反射防止効果を担う第1層、第2層及び第3層を順次設けてなるものである。 反射防止膜は実質的に $\lambda / 4 膜 - \lambda / 2 膜 - \lambda / 4 膜を基本膜設計とする反射防止層を育するのが好ましい。$

先ず下地層は、二酸化ケイ素からなり、その膜厚は実用上0.45~0.551の範囲が好ましい。下地層を設けた理由は、基材と反射防止膜と

の3届等価膜は前述の $\lambda/4 膜 - \lambda/2 膜 - \lambda/4 膜$ がらなる基本膜設計において、最初の $\lambda/4 膜$ に相当する。その膜厚は実用的には 0. $22 \sim 0$. 28λ の範囲が好ましい。第1 届を構成する物質として二酸化チタンと二酸化ケイ素とを選択し、下地届から数えて二酸化チタン層、二酸化ケイ素層および二酸化チタン層の順で成膜された 3 届等価膜とした理由は、以下の(イ)

- (ロ)に述べる通りである。
- (イ) これらの2物質からなる3層等価膜にすることにより、第1層の屈折率を例えば1.65~1.80に、そして膜厚を例えば0.22~0.28 λとそれぞれ所望の値に調整でき、この第1層と、下地層および第2層、第3層との組み合せによって優れた反射防止効果が得られる。
- (ロ) 二酸化チタン層と二酸化ケイ素層によって 形成される3層等価膜は耐熱性が高く、かつ 前記下地層の二酸化ケイ素に対しても後記第 2層の二酸化チタンに対しても付着力がある。

次に前記の第1層の上に形成される第2層は、二酸化チタンからなり、前述の $\lambda/4$ 膜 $-\lambda/2$ 膜 $-\lambda/4$ 膜 からなる 基本 膜 設計において、 $\lambda/2$ 膜に相当し、その 膜厚は 実用的には 0.4 5 -0.55λ の 範囲である。 第2層を 構成する物質として、二酸化チタンを 選択した 理由は、以下に述べる 通りである。

- (a) 二酸化チタンは屈折率が約2.40と高屈折率物質であり、高屈折率の二酸化チタンからなる、この第2層を、二酸化チタンと二酸化ケイ素とを用いた前記の低屈折率の3層等価膜からなる第1層と後記の低屈折率の二酸化ケイ素からなる第3層との間に配置させることにより、所望の反射防止効果が得られる。
- (b) 二酸化チタンは第1層および第3層に対して付着力がある。

尚、実用的には第2層の屈折率は2.40~2. 45の範囲である。

次に前記の第2層の上に形成される第3層は、 二酸化ケイ柔からなり、前述の1/4膜-1/2

の再現性も悪化する。例えば眼鏡レンズの場合、一対で使用するため左右のレンズの順厚の誤差が大きくて、干渉色の再現性が悪化すると、商品価値が低下してしまう。

- (11) 反射防止膜を構成する層の数を増していくと、 一般に反射防止膜にクラックが発生しやすくな るが、3層からなる本発明の反射防止膜におい てはクラックが発生しにくい。
- (111) 物質および膜厚を上述の如く設定すれば、 3層でも充分な反射防止効果が得られる。

本発明の反射防止膜においては、前記3層等価膜からなる第1層中の二酸化チタン層および第2層の二酸化チタンの蒸糖方法は、基材に酸素イオンピームを照射しながら蒸着するイオンピームアシスト法に限定される。その理由は、このイオンピームアシスト法によらないと、硬度が十分な二酸化チタン層を形成することができず、また二酸化チタンの屈折率が2.40以上までにならないからである。このイオンピームアシスト法における条件(例えば基材への酸素イオンピームの照射

膜 $-\lambda/4$ 膜からなる基本膜設計において、 最後の $\lambda/4$ 膜に相当し、その膜厚は実用的には $0.22 \sim 0.28 \lambda$ の範囲である。第3 層を構成する物質として、二酸化ケイ素を選択した理由 は、以下に述べる通りである。

- ① 二酸化ケイ素は屈折率約1.46の低屈折率 物質であり、この屈折率の二酸化ケイ素からな る第3層を、低屈折率の第1層上に設けられた 高屈折率の第2層の上に設けることにより、所 望の反射防止効果が得られる。
- ② 二酸化ケイ素膜は膜強度が強く、かつ二酸化 チタンからなる第2層に対する付着力が強い。 尚、実用的には第3層の屈折率は1.45~ 1.47の範囲である。

上述の如く本発明の反射防止膜は、反射防止効果を担う層が3層からなるが、3層に限定した理由は以下の通りである。

(1) 反射防止膜の層数を増していくと、一般に反射防止域は広くなるが、層数が多い程、製品毎の反射防止膜の膜厚の再現性が低下し、干渉色

方法、原料である二酸化チタンの蒸発方法など) は通常採用されている条件の中から適宜選択される。

なお、上述の如く第1層中の二酸化チタン層および第2層の二酸化チタンの蒸糖はイオンビームアシスト法により行なわれるが、残りの下地層の二酸化ケイ素、3層等価膜からなる第1層中の二酸化ケイ素層、第3層の二酸化ケイ素は、真空蒸稽法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、CVD法などの通常の成膜手段により形成される。

本発明の反射防止膜が形成されるプラスチック 基材としては、プラスチックレンズを用いるのが 好ましく、その例としてセルロース系プラスチックレンズ、ジエチレングリコールピスアリルカー ボネート単独重合体又はジエチレングリコールピ スアリルカーボネートと1種以上の他のモノマー との共重合体からなるプラスチックレンズ、ポリスチックレンズ、ポリカー カーボネート系プラスチックレンズ、ポリカレタン系プラスチックレンズ、ポリウレタン系プラスチック チックレンズ、ポリ塩化ビニル系プラスチックレンズ等が挙げられる。

これらのプラスチックレンズ基材は表面処理を 施したものでも良く、表面処理の具体例としては プラスチックレンズ基材上に有機物(例えば有機 ケイ素化合物)、無機物(例えばコロイダルシリ カ)またはこれらの混合物からなる表面処理機を 形成することが挙げられる。

[実施例]

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもではない。

なお実施例および比較例で得られた反射防止膜 は、以下に示す試験方法により、諸物性を測定し た。

(a) 耐擦傷性

#0000のスチールウールにより表面を往復回数で10回こすって耐掠傷性を次のように判定した。

A:わずかに傷がつく

により二酸化ケイ素からなる下地層 [屈折率 1.46、膜厚 0.5 λ (λは 550 nm である)] を 形成した。

次にこの下地層の上に、プラスチックレンズを加熱した状態でプラスチックレンズに酸素イオンピームを照射するイオンピームアシスト法にて二酸化チタンからなる層(膜厚 0.06 λ)、真空蒸着法にて二酸化ケイ素からなる層(膜厚 0.1 2 λ)、さらにイオンピームアシスト法にて二酸化チタンからなる層(膜厚 0.06 λ)よりなる3 届等価膜である第 1 層 [屈折率 1.70、膜厚 0.24 λ]を形成した。

次にこの第1層の上に、プラスチックレンズを 加熱した状態でプラスチックレンズに酸素イオン ビームを照射するイオンビームアシスト法により 二酸化チタンからなる第2層(屈折率2.40、 膜厚0.51、を形成した。

次にこの第2届の上に、真空蒸着法(真空度2 ×10⁻⁵ Torr) により二酸化ケイ素からなる 第3届(屈折率1.46、膜厚0.25 λ) を形 B:多く傷がつく

C:膜のはがれが生じる

(b) 密着性

JIS-2-1522に従いゴバン目を10× 10個作りセロファン粘着テープにより剥離試験 を3回行ない、残ったゴバン目の数を数えた。

(c) 視感透過率、視感反射率

日立製作所製340自記分光光度計を用い、視感透過率、視感反射率を測定した。

(d) 耐熱性

電気炉内にて80℃で10分間加熱しクラック の発生を調べ、次のように判定した。

〇:クラック発生せず

×:クラック発生

実施例1

プラスチックレンズとして、ジエチレングリコールピスアリルカーボネート重合体系プラスチックレンズ (HOYA(株製Hi-Lux、屈折率1.499)を用い、このプラスチックレンズ上に先ず真空蒸着法(真空度2×10-5Torr)

成して、反射防止膜付きプラスチックレンズを得 *

得られた反射防止膜付きプラスチックレンズの 試験結果を、表-1に示す。同表に示すように、 実施例1で得られた反射防止膜付きプラスチック レンズは、耐擦傷性、密着性が良好であるだけで なく、耐熱性に優れ、視感反射率が0.4%と反 射防止効果に優れたものであった。なお、実施例 1で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズ の反射率曲線を第1図に示す。

実施例2

プラスチックレンズとしてジエチレングリコールピスアリルカーボネート共重合体系プラスチックレンズ(HOYA㈱製Hi-LuxII、屈折率1.56)を用い、表-1に示す膜構成にて反射防止膜付きプラスチックレンズを得た。実施例2で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズも表-1に示すように、耐擦傷性、密着性が良好であるだけでなく、耐熱性に優れ、視感反射率が0.4%と反射防止効果に優れたものであった。

なお実施例2で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズの反射率曲線を第2図に示す。

比較例1

プラスチックレンズとしてジエチレングリコールビスアリルカーボネート重合体系プラスチックレンズ(HOYA蝌製Hi-Lux)を用いた。このプラスチックレンズ上に、特開昭56-116003号公報に記載の反射防止膜と同様に、二酸化ケイ素からなる下地層(膜厚1.5 λ)を設けた後、二酸化ジルコニウム層(膜厚0.06 λ)と二酸化ケイ素層(膜厚0.08 λ)との2層等価膜からなる第1層(合計膜厚0.14 λ)、二酸化ジルコニウムからなる第2層(膜厚0.5 λ)および二酸化ケイ素からなる第3層(膜厚0.5 λ)および二酸化ケイ素からなる第3層(膜厚0.25 λ)を順次設けて、本比較例の反射防止膜付きプラスチックレンズを得た。

本比較例で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズは、耐擦傷性、密着性は良好であったが、耐熱性が不充分で、しかも視感反射率が1.5%と実施例1の反射防止膜付きプラスチックレンズ

と比べ反射防止効果が劣るものであった。 なお比較例1で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズの反射率曲線を第3図に示す。

比較例2

プラスチックレンズとして、ジエチレングリコールピスアリルカーボネート重合体系プラスチックレンズ(HOYA㈱製Hi-Lux)の代りにジエチレングリコールピスアリルカーボネート共重合体系プラスチックレンズ(HOYA㈱製Hi-LuxII)を用いた以外は比較例1と同様にして反射防止膜付きプラスチックレンズを得た。なレンズは、耐擦傷性、密着性が良好であったが、耐熱性が不充分で、しかも視感反射率が1.5%に大変を開発したである。なお比較例4で得られた反射防止膜付きプラスチックレンズの反射等曲線を第4図に示す。

表-1

| | | | 層 | 構 | 成 | | | 耐擦 | 密着性 | 耐熱性 | 視感 | 視感 |
|------|------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|---------|-----|--------|--------|
| | 基板 | 下地屬 | 3 | 第 1 層 | | 第2層 | 第3層 | 傷性 | | | 透過率(%) | 反射率(%) |
| 実施例1 | (1) | SiO ₂ | TiOz SiOz | 0.06 λ 0.12 λ | | TiOz | SiO | A | 100/100 | 0 | 99.6 | 0.4 |
| | | 0. 5λ | TiO ₂ | 0.06 λ | | 0. 5 l | 0.25 A | | | | | |
| | | | (合計膜厚0.24 A) | | | | | | | | | |
| 実施例2 | (11) | | TiOz | 0.06λ | | · | } | A | 100/100 | 0 | 99.6 | 0.4 |
| | | SiO ₂ | SiO | 0.12 λ | | TiO ₂ | SiO ₂ | | | | | |
| | | 0. 5λ | TiOt | 0.06λ | | 0. 51 | 0.25 ス | | | | | |
| | | | (合語 | †膜厚0. | 24 A) | | | | | | | |
| 比較例1 | (1) | SiO ₁ | 2101 | 0.06 λ | | 101Z | SiO ₂ | A | 100/100 | × | 98.5 | 1.5 |
| | | 1. 51 | SiOt | 0.08λ | | 0. 5l | 0.25 ス | | | | | |
| | | | (合計膜厚O.14 A) | | | | | | | | | |
| 比較例2 | (11) | SiOt | 2101 | 0.06λ | | ZrOt | SiO _t | A | 100/100 | × | 98.5 | 1.5 |
| | | 1. 5ì | SiO | 0.08λ | | 0. 5l | 0.25 A | | | | | |
| | | | (合語 | 计膜厚0. | 14λ) | | | <u></u> | | | | |

(1):ジエチレングリコールピスアリルカーポネート重合体

(Ⅱ):ジエチレングリコールピスアリルカーポネート共重合体

[発明の効果]

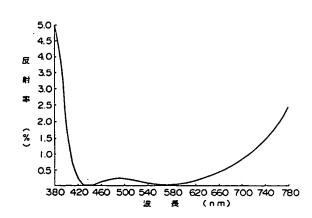
以上詳述したように、本発明の反射防止膜は、これをプラスチック基材上に設けたときに耐擦傷性、密着性が良好であるばかりでなく、耐熱性が良好でクラックも発生しにくく、また視感反射率が極めて低く、優れた反射防止効果を有し、ゴースト現象も解消されるので、反射防止能を有する眼鏡用レンズとして特に好適に用いることができる。

4.図面の簡単な説明

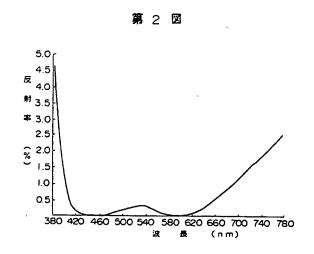
第1図は実施例1の反射防止膜付きプラスチックレンズにおける反射率曲線図、第2図は実施例2の反射防止膜付きプラスチックレンズにおける反射率曲線図、第3図は比較例1の反射防止膜付きプラスチックレンズにおける反射率曲線図、第4図は比較例2の反射防止膜付きプラスチックレンズにおける反射率曲線図である。

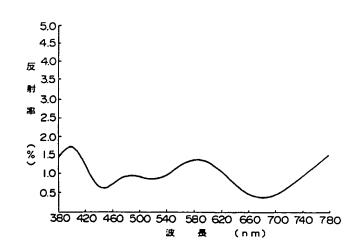
出願人 ホーヤ株式会社代理人 弁理士 中村静男





第3図





第 4 図

